

OPC Products and Services

OPC データ変換サービス

Benchmark Technologies 社(以下 Benchmark 社)では、新しく業界をリードする MicroUnity OPC ソフトウェア ソリューションを使って可能にした光学的近接効果補正設計サービスを提供しています。このソフトウェアは、光強度の勾配を均等化させる集積回路パターン設計を付け加えることによって光学的近接効果補正を実現させる最先端の技法や技術を提供します。

Benchmark 社の変換サービスでは、ユーザのデバイス データについて光学的近接効果を補正します。その結果、焦点深度およびパターン転写性が驚くほど強化されます。詳しくは、リソテックジャパン株式会社(TEL 048-258-6775)へお問い合わせ下さい。

OPC ソフトウェア

現在 Benchmark Technologies 社は、欧州、イスラエル、および米国の一定地域における MicroUnity OPC ソフトウェア ソリューションの専売者です。

- MaskRigger は、光学的近接効果、およびそれによる転写忠実度の損失を補正するサブリソグラフィのパターンを作成する幾何学エンジンです。
- EBView を使えば、設計者がそれらのパターンを表示させ、元のデザインとの互換性を確かめることができます。

上記のソフトウェア ソリューションに関する詳細については、弊社にお問い合わせください。

評価向け OPC 標準化構造

Benchmark 社は、最近、SEMATECH の OPC 基準レティクル(J111A レティクルとも呼ばれている)を開発、製品化、販売する独占ライセンスを獲得しました。メンバー会社との協同契約に基づき SEMATECH によって設計された OPC 基準レティクルは、光学的近接効果補正に使用されるハードウェアおよびソフトウェアの設計と評価のいずれにも役立ちます。

この基準レティクルは強力なツールであるため、検査装置メーカーやソフトウェア開発者が OPC アプリケーションの設計時に利用することができます。さらに、オペレータが同レティクルを使って、OPC ソフトウェアおよび装置の特性を測定したり、評価したりすることもできます。詳しくは、リソテックジャパン株式会社(TEL 048-258-6775)

へお問い合わせ下さい。

パターンのサイズが $0.25 \mu\text{m}$ より小さくなるに従って、光学的近接効果の補正や解析に用いられる技術の重要性は増えています。光学的近接効果によって生ずる問題には、以下のようなものがあります。

- 孤立ラインと密集ラインの寸法の差で、CD オフセットとも呼ばれる
- ライン エンド ショートニングと丸まり
- パターンのコーナー部および交点部、とりわけ密集パターンにおけるパターン忠実度の低下

光学的近接効果補正の技術を採用することで、時間とコストを大幅に節減でき、しかもプロセス裕度の改善につながります。最近とみに OPC が、高度幾何学的配列の量産において大黒柱のような存在になっています。

現在 Benchmark 社は、OPC サービスと製品を提供しています。詳しくは、リソテックジャパン株式会社(TEL 048-258-6775)へお問い合わせ下さい。

Benchmark テスト レティクル

Benchmark 社の OPC 製品およびサービスは、実地証明済みの一連の Benchmark グラフィック テスト レティクルを補って完全にするものです。さまざまなシステム、レンズ、プロセスの特性の定量化や評価に使用される Benchmark レティクルには、比類ない正確性、安定性、反復性が保証されています。